

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年 5月 28日現在

機関番号:10101			
研究種目:基盤研究	(B)		
研究期間:2010~20	12		
課題番号:22360271			
研究課題名(和文)	酸化物薄膜トランジスタにおける巨大熱電能の電界変調と赤外線センサ 一応用		
研究課題名(英文)	${\small {\sf Electric Field Modulation of Giant Thermopower in Oxide Thin Film}}$		
	Transistors and its Application for IR Sensor		
研究代表者			
太田 裕道(OHTA HIROMICHI)			
北海道大学・電子科学研究所・教授			
研究者番号:80372530			

研究成果の概要(和文):酸化物半導体SrTiO3単結晶上にトップゲート型薄膜トランジスタ構造 を作製し、次にゲート電圧印加によって形成される極薄2DEG層の電子輸送及び熱電能Sを詳細 に測定・解析した。その結果、①用いるゲート絶縁体として含水ナノ多孔質ガラス(CAN: H. Ohta et al., Nature Commun. 1:118 (2010); Adv. Mater. 24, 740 (2012)) が極めて有用であり、② 含水ナノ多孔質ガラスにより極薄2DEGが誘起できるのはEcBM > EH2の酸化物半導体であるこ とを明らかにした。また、赤外線センサー特性を決定づける熱電特性についてバルクー人工超格 子-電界誘起極薄2DEGの比較を行ったところ、体積キャリア濃度<3×10<sup>20</sup> cm<sup>-3</sup>では電界誘起 2DEGとバルクの熱電特性は変わらないが、4×10<sup>20</sup> cm<sup>-3</sup>以上のキャリア濃度において極薄2DEG は人工超格子と同様にバルクの5倍の熱電能(=25倍の性能指数ZT~2)を示し、赤外線センサー として有用であることが分かった。

研究成果の概要(英文): Top-gate type thin film transistor structure was fabricated on an oxide semiconductor, SrTiO<sub>3</sub> single crystal plate. The electron transport and the thermopower *S* for the extremely thin two-dimensional electron gas, which can be formed on the SrTiO<sub>3</sub> crystal by a gate voltage application, were precisely measured / analyzed. As a result of this study, followings were clarified. 1) Water incorporated nano-porous glass [CAN: H. Ohta *et al.*, *Nature Commun.* 1: 118 (2010); *Adv. Mater.* 24, 740 (2012)] is very useful as a gate insulator. 2) Extremely thin 2DEG can be generated on the oxide semiconductor surface when  $E_{CBM}$  of the oxide semiconductor is greater than  $E_{H2}$ . 3) Extremely thin 2DEG ( $n_{3D} > 4 \times 10^{21}$  cm<sup>-3</sup>) exhibited unusually large *S*-value, which is five times larger than that of bulk (Figure of merit, *ZT*~2). This clearly demonstrates that the transistor approach works well as the thermoelectric infrared sensor.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2010年度	6, 900, 000	2, 070, 000	8, 970, 000
2011年度	3, 100, 000	930,000	4,030,000
2012年度	3, 200, 000	960,000	4, 160, 000
年度			
年度			
総計	13, 200, 000	3, 960, 000	17, 160, 000

交付決定額

研究分野:工学 科研費の分科・細目:材料工学・無機材料・物性 キーワード:二次元電子ガス、熱電能、電界変調、赤外線センサー 1.研究開始当初の背景 縮退半導体/絶縁体人工超格子や誘電体/ 半導体ヘテロ界面に形成される厚さが熱的 ド・ブロイ波長以下の極薄二次元電子ガス (2DEG)層は、量子化準位形成による状態 密度(DOS)増大により、金属的な高い電気 伝導度を維持したまま、バルクの数倍 (SrTiO<sub>3</sub>の場合、厚さ 3.905 Å の 2DEG 層 はバルクの5倍)の巨大熱電能( $S \propto \partial$  DOS/  $\partial E$ )を示す [H. Ohta *et al.*, *Nature Mater.* 6, 129 (2007)]。

例えば、SrTiO<sub>3</sub>の 2DEG 層のみの熱電変 換性能指数  $[ZT = S^2 \bullet \sigma \bullet T \bullet \kappa^1, CC \sigma, \kappa]$ は導電率と熱伝導率]は室温で最大 2.4 と見 積もられ、熱電変換材料実用化の目安とされ る ZT = 1 を超えるが、①2DEG 層が極めて 薄く、2分厚い絶縁層が必要で、3熱電特性 の変調が難しいため、実用化は極めて困難で ある。しかし、基礎科学的には 2DEG 層の巨 大 S は非常に興味深い。現在の研究戦略は、 熱電特性の変調である。前述のように、2DEG 層は人工超格子やヘテロ界面に自然に形成 される他、絶縁体/半導体ヘテロ界面に電界 を印加することで強制的に作製できると考 えられる。また、巨大 S値の電界変調ができ れば、熱電発電や熱電冷却のようなパワーデ バイスではなく、赤外線センサーのような小 型デバイスへの応用は十分可能と考えられ る。

## 2. 研究の目的

酸化物熱電材料として知られる SrTiO3 上に 薄膜トランジスタ(TFT)構造を作製し、高 いゲート電圧を印加することで電界誘起 2DEG層の厚さを熱的ド・ブロイ波長以下に 制御することで、三次元伝導体であるバルク の5倍以上の巨大熱電能を電界変調し、その 赤外線センサー(熱電)特性を明らかにする ことを目的とした。極薄 2DEG 層の巨大 S 値 の電界変調は提案者独自の研究であり、結果 は熱電材料学者にとって有用な設計指針を 与えると期待した。

#### 3. 研究の方法

SrTiO<sub>3</sub>などの酸化物半導体単結晶または薄 膜上に、様々な酸化物をゲート絶縁体として 用いた TFT 構造を作製し、トランジスタ特 性を調査した。キャリア濃度・移動度および 熱電能(図1および図2)などの電子輸送特 性は室温および室温以下(極低温)で測定し、 得られる測定結果を半導体デバイスシミュ レータにより解析した。またキャリア蓄積前 後のゲート絶縁体の構造を高分解能走査型 透過電子顕微鏡で観察・計測した。



図 1 電界誘起二次元電子ガスの巨大熱電 能のイメージ。例えば n型熱電材料上に薄 膜トランジスタ構造を作製し、大きな正の ゲート電圧を印加することで人工超格子を 作製することなく、巨大熱電能を示す極薄 二次元電子ガスを実現できる。



図 2 薄膜トランジスタ構造の熱電能計測 の様子。2つのペルチェ素子を用いて 400 ミクロンのチャネルに温度差を付与し、そ の温度差を2本の極細熱電対で計測すると ともに、チャネルに発生する熱起電力を計 測した。

### 4. 研究成果

# (1)含水ナノ多孔性ガラスの発見-液体の水 が固体ゲート絶縁体に-

ゲート絶縁体 C12A7 薄膜の作製条件を種々 検討した結果、直径約 10 nm のナノポアを体 積分率 40%含有するナノ多孔性ガラスが作 製できることを見出した(図 3)。各種分析の 結果、このナノポアは超純水で満たされてい ることが分かった。大気中の湿気を毛細管効 果で吸い込んだ、いわばスポンジである。こ の含水ナノ多孔性ガラス(以下 CAN: Calcium Aluminate with Nanopore)をゲー



図 3 (上) 含水ナノ多孔性ガラス CAN 薄 膜の断面透過型電子顕微鏡像。CAN 薄膜 中に白く見えているのが直径 10 nm 程度 のナノポア。(下) CAN 薄膜中の水の昇温 脱離スペクトル。280℃に大きな水の脱離 ピークが見られる。水の体積含有率は約 40%。

ト絶縁体として用いてSrTiO<sub>3</sub>-FETを作製し、 ゲート電圧を印加するとナノポア中の水の 電気分解が起こることが分かった。正電圧印 加時にはSrTiO<sub>3</sub>表面に押し付けられたH+ (=H<sub>3</sub>O+)イオンがSrTiO<sub>3</sub>中の伝導電子を 引き付け、SrTiO<sub>3</sub>表面は極薄金属に変化する。 これによって並行平板配置での水電解が起 こるのである。CANを用いることで液体の 水を固体のように扱うことができ、かつ電気 二重層トランジスタを超える高濃度シート キャリアが蓄積可能であることが分かった。

(2)電界誘起二次元電子ガスの巨大熱電能変調

図4にSrTiO<sub>3</sub>-FETのシートキャリア濃度と |S|値の関係(室温)をまとめて示す。なお、 CANゲートSrTiO<sub>3</sub>-FET はメモリ効果を示 すことから、計測はゲート電圧印加→熱電能 →Hall効果のように逐次的に行われた。CAN ゲートSrTiO<sub>3</sub>-FETのシートキャリア濃度は ゲート電圧・印加時間の増加に伴って増加し、 水を含まないC12A7で誘起可能な濃度を二 桁も上回る~2×10<sup>15</sup> cm<sup>-2</sup>の高濃度シートキ ャリアが誘起できることが分かった。また、 |S|値はシートキャリア濃度の増加に伴い一



図 4 CAN ゲートトランジスタのチャネ ルのシートキャリア濃度と熱電能の関係 (室温)。トランジスタチャネルの熱電能 |*S*|はゲート電圧(=シートキャリア濃度) の増加に伴って一旦減少したが、シートキ ャリア濃度が 2.5×10<sup>14</sup> cm<sup>-2</sup>を超えるとバ ルクの5倍に増大した。



図 5 CAN ゲートトランジスタの有効チャ ネル厚さと熱電能の関係(室温)。有効チ ャネル厚さが 2 nm 以下になると急激に熱 電能が増大することが分かった。

旦減少したが、シートキャリア濃度が 2.5 ×10<sup>14</sup> cm<sup>-2</sup>のときに 270 μVK<sup>-1</sup>を極小とし て、それ以上のシートキャリア濃度になると 再び増大する、V 字回復を示した。

このV字回復現象を検証するため、デバイ スシミュレータによるキャリアデプスプロ ファイル計算を行い、バルク SrTiO<sub>3</sub>のキャ リア濃度と熱電能の関係を用いて 2DEG 層 の熱電能を算出し、実験データと比較した。 シートキャリア濃度が 2.5×10<sup>14</sup> cm<sup>-2</sup>以下の 領域においては |*S*|値の実測値はバルクの計 算値(点線)とほぼ一致したが、それ以上の シートキャリア濃度になると |*S*|値はバルク の5倍に増大し、その巨大熱電能が電界変調 できることが分かった。また、このとき 2DEG 層の有効厚さは~2 nm と見積もられ、 熱的ド・ブロイ波長よりも薄くなっている (図 5)。

(3) 電界誘起二次元電子ガスの熱電特性

**TFT** 構造の | *S* | 値のキャリア濃度依存性を バルク及び SrTiO3 人工超格子と比較するた め、|S|値をシートキャリア濃度/有効厚さ(≈ キャリア濃度)に対してプロットした(図6)。 キャリア濃度/有効厚さが 4×10<sup>20</sup> cm-3以下の とき、FET 構造の | S | 値はバルク及びバルク の計算値(点線)とよく一致し、シートキャ リア濃度/有効厚さが一桁上昇すると|S|値 は200 µVK-1減少する。また、キャリア濃度 /有効厚さが 4×10<sup>20</sup> cm-3 を超えるとバルクの ラインから外れて FET の | S | 値は上昇し、 SrTiO3 人工超格子で観測されたバルクの 5 倍に相当する |S| 値に近い値を示すことが分 かった。すなわち、FET 構造を用いた熱電能 電界変調法により、試料一つで SrTiO<sub>3</sub>の | S| 値とキャリア濃度の関係が明らかにできる とともに、人工超格子を作製することなく性 能の良い熱電材料を創製することが可能と いえる。



図 6 バルク、人工超格子とトランジスタ 構造の熱電能の比較。

(4)含水ナノ多孔性ガラスでキャリア濃度電 界変調可能な酸化物半導体 含水ナノ多孔性ガラス CAN をゲート絶縁体 として用いて種々の酸化物半導体(KTaO<sub>3</sub>、 SrTiO<sub>3</sub>、TiO<sub>2</sub>、WO<sub>3</sub>)薄膜トランジスタを作 製し、ゲート電圧印加によって形成される極 薄 2DEG 層の電子輸送及び S を、酸化物半 導体の伝導帯下端のエネルギー(*E*<sub>CBM</sub>)と水 素発生電位(*E*<sub>H2</sub>)の関係に着目して調査し た。

**KTaO3**と**SrTiO3**(*E*CBM > *E*H2)では、ゲート電圧印加に伴いシートキャリア濃度が 急激に増加した。|S|値は一旦減少したが、 キャリア濃度が  $2 \times 10^{14}$  cm<sup>-2</sup>を越えると増大 し、バルクの5倍に相当する大きな値を示し た。一方、WO3 エピタキシャル薄膜(*E*CBM < *E*H2)を活性層とした場合、ゲート電圧印加 に伴い熱電能は単調減少し、KTaO3とSrTiO3 に見られたV字回復現象は見られなかった。 以上の結果から、CANを用いる極薄二次元 電子ガスのキャリア電界変調のポイントは *E*CBM と *E*H2 の関係であり、含水ナノ多孔質 ガラスにより極薄 2DEG が誘起できるのは *E*CBM > *E*H2 の酸化物半導体であることが明 らかになった(図 7)。



図7 n型酸化物半導体上のCANゲートト ランジスタ構造とキャリア電界変調。伝導 帯下端エネルギーが水素発生電位よりも高 エネルギー側にあるSrTiO<sub>3</sub>やKTaO<sub>3</sub>では 図 c のように H<sub>3</sub>O+によるキャリア濃度変 調と、大きな熱電効果を示す極薄二次元電 子ガスが実現する。 5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計9件)

[1] H. Jeen, W. S. Choi, J. W. Freeland, <u>H.</u> <u>Ohta</u>, C. U. Jung, and H. N. Lee, "Topotactic Phase Transformation of the Brownmillerite SrCoO<sub>2.5</sub> to the Perovskite SrCoO<sub>3-6</sub>", *Adv. Mater.* (2013). In press. 査 読有

[2] <u>H. Ohta</u>, "Electric-field thermopower modulation in SrTiO<sub>3</sub>-based field-effect transistors", *J. Mater. Sci.* 48, 2797-2805 (2013). 査読有

(DOI 10.1007/s10853-012-6856-6)

[3] S. Zheng, C. A. J. Fisher, T. Kato, Y. Nagao, <u>H. Ohta</u>, and Y. Ikuhara, "Dom ain formation in anatase  $TiO_2$  thin films on LaAlO<sub>3</sub> substrates", *Appl. Phys. Let* t. 101, 191602-1-5 (2012). 査読有 (DO I 10.1063/1.4766338)

[4] <u>H. Ohta</u>, T. Mizuno, S. Zheng, T. Kato, Y. Ikuhara, K. Abe, H. Kumomi, K. Nomura, and H. Hosono, "Unusually large enhancement of thermopower in an electric field induced two-dimensional electron gas", *Adv. Mater.* 24, 740-744 (2012). 査 読有 (DOI 10.1002/adma.201103809)

[5] <u>太田裕道</u>, "電界誘起二次元電子ガスの巨 大熱電能変調", セラミックス 47, 520-523 (2012). 査読無

(http://ci.nii.ac.jp/naid/40019323264)

[6] <u>太田裕道</u>, "チタン酸ストロンチウムの熱 電ゼーベック効果", 応用物理 81, 740-745 (2012). 査読無

(http://ci.nii.ac.jp/naid/40019428632)

[7] T. Mizuno, Y. Nagao, A. Yoshikawa, K. Koumoto, T. Kato, Y. Ikuhara, and <u>H. Ohta,</u> "Electric field thermopower modulation analysis of an interfacial conducting layer formed between Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and rutile TiO<sub>2</sub>", *J. Appl. Phys.* 110, 063719 (2011). 査読有 (DOI 10.1063/1.3633217)

[8] Y. Nagao, A. Yoshikawa, K. Koumoto, T. Kato, Y. Ikuhara, and <u>H. Ohta,</u> "Experimental characterization of the electronic structure of anatase TiO<sub>2</sub>: Thermopower modulation", *Appl. Phys. Lett.* 97, 172112 (2010). 査 読 有 (DOI 10.1063/1.3507898)

[9] H. Koide, Y. Nagao, K. Koumoto, Y. Takasaki, T. Umemura, T. Kato, Y. Ikuhara, and <u>H. Ohta</u>, "Electric field modulation of thermopower for transparent amorphous oxide thin film transistors", *Appl. Phys. Lett.* 97, 182105 (2010). 査 読 有 (DOI

## 10.1063/1.3512870)

〔学会発表〕(計 48 件)

[1]H.Ohta,"Twodimensionalthermoelectriceffect",DistinguishedLectureSeries for 2012 fall semester inSungkyunkwanUniversity,SungkyunkwanUniversity,SungkyunkwanUniversity,YangkyunkwanUniversity,12 月 12 日 (招待講演)

[2] <u>H. Ohta</u>, "Electric field thermopower modulation of 2DEG in oxide semiconductor based field effect transistors", MRS 2012 Fall Meeting, Hynes Convention Center, Boston, USA, 2012 年 11 月 26 日-30 日 (招待講演)

[3] <u>H. Ohta</u>, "Unusually large thermopower enhancement in an electric field induced two-dimensional electron gas", E-MRS 2012 Spring Meeting, Congress Center, Strasbourg, France, 2012 年 5 月 14 日-18 日 (招待講演)

[4] <u>H. Ohta</u>, "Electric-Field Thermopowe r Modulation Method", International wor kshop Japan-Finland March Meeting for the future in thermoelectrics, Nagoya

Univ., Nagoya, 2012年3月13日(招待講演) [5] <u>太田裕道</u>, "高分解能X線回折法による金 属酸化物薄膜の分析", 第240回X線分析研究 懇談会, 名古屋大学(名古屋), 2011年12月2 日(招待講演)

[9] <u>H. Ohta</u>, Y. Sato, T. Kato, S-W. Kim, K. Nomura, Y. Ikuhara, and H. Hosono, "Water electrolysis induced 2D metal formation in SrTiO<sub>3</sub>", the XX International Materials Research Congress 2011 (IMRC 2011), Hotel Casa Magna Marriot, Cancun, Mexico, 2011 年 8 月 17 日

[10] <u>太田裕道</u>, "温度差で発電する熱電材料-酸化物の挑戦", 超精密加工専門委員会第 62 回研究会, 大阪ガーデンパレス(大阪), 2011 年 7月13日(招待講演)

[11] <u>太田裕道</u>, "チタン酸ストロンチウムの 熱電現象",新化学発展協会 電子情報技術 部会講演会,新化学発展協会会議室(東京)、 2011 年 3 月 28 日(招待講演)

[12] <u>太田裕道</u>, "水の電気分解を利用した SrTiO<sub>3</sub>の金属化と熱電能", 第55回固体イオ ニクス研究会「遷移金属複合酸化物:新しい 合成法,物質,物性」,京都国際会館(京都), 2011年1月26日(招待講演)

[13] <u>太田裕道</u>, "酸化物半導体における熱電 能のゲート電界変調", 第5回 KEK 連携研究 会「熱電変換材料と新規機能物質」, 筑波大 学(つくば), 2010年12月18日(招待講 演)

[14] <u>太田裕道</u>, "チタン酸ストロンチウムの 熱電能", 第19回強相関コアセミナー,産総研

つくば中央(つくば)、2010年12月17日(招 [その他] ○ホームページ 待講演) [15] Hiromichi Ohta, "Electric Field http://functfilm.es.hokudai.ac.jp/ Modulation of Thermopower for SrTiO<sub>3</sub>", ○新聞報道等(計11件) MRS 2010 spring meeting, Moscone West Convention Center, San Francisco, CA, [1]「熱電材料 名大などが新評価法 電界効 2010年4月5日-9日(招待講演) 果トランジスタ活用」,日刊工業新聞(2012) 他 33 件 年1月9日) [2]「温度差使う熱電効果 名大,起電力を5 〔図書〕(計2件) 倍に 薄膜トランジスタ型で」,日経産業新 [1] 太田裕道, サーマルマネジメント~余 間(2012年1月5日) 熱・排熱の制御と有効利用(分担:第4編 第 [3]「名古屋大大学院 熱電材料の性能1試料 2章 4. 電界効果を利用した熱電材料の評 で最適化 電界効果利用 新評価手法を開 価手法の開発), pp. 247-253, エヌ・ティ・ 発」, 電波新聞(2012年1月4日) [4]「名大など、電界効果を利用した熱電材料 エス (2013). [2] H. Ohta, K. Koumoto, Multifunctional の性能最適化手法を開発」, Yahoo! JAPAN ニュース (Web) (2011 年 12 月 28 日) Oxide Heterostructures (Chapter 10 [5]「簡単・安価に熱電材料 水を利用し絶縁 Thermoelectric oxides: films and 体から作製 名大・太田准教授ら」,科学新 heterostructures), pp.296 - 316, Oxford 間(2010年12月3日) (2012).[6]「JST と名古屋大学 新熱電材料実用化へ 〔産業財産権〕 希少金属使わずに特性発現」,鉄鋼新聞 ○出願状況(計3件) (2010年11月24日) [1]チタン酸ストロンチウム用のエッチング [7]「名大など、水の電気分解利用し絶縁体か 液組成物、形状加工されたチタン酸ストロン ら熱電材料を作製--JST 課題解決型基礎研究 チウム膜の製造方法及びチタン酸ストロン の一環として実施」、Tech-On!(Web)(2010 チウム膜の加工方法 年11月17日) 発明者:小野貴司,萩原三雄,藤村 悟史, [8]「熱を電気に変換する金属材料を開発」, NHK おはよう東海(2010年11月17日) 太田裕道 [9]「熱を電気に。新材料」, NHK おはよう 権利者:東京応化工業株式会社,国立大学法 人名古屋大学 日本(2010年11月17日) 種類:特許 [10]「絶縁体から高熱電性能-名大,金属シ 番号:特開 2013-23409 ート作製」、日刊工業新聞(2010年11月17 出願年月日: 2011年07月21日 日) [11]「工場や車の廃熱→電気に変換材料低コ 国内外の別:国内 [2]多孔性絶縁体及び電界効果トランジスタ スト製造-名大など、水を使う技術開発」,中 発明者:太田裕道,水野 拓,小野貴司,萩 日新聞(2010年11月17日) 原三雄 6. 研究組織 権利者:国立大学法人名古屋大学,東京応化 工業株式会社 (1) 研究代表者 種類:特許 太田 裕道 (OHTA HIROMICHI) 番号:特開 2012-33910 北海道大学・電子科学研究所・教授 出願年月日:2011 年 06 月 29 日 (優先日 研究者番号:80372530 2010.6.30) (2) 研究分担者 国内外の別:国内 なし [3] 電界効果トランジスタ及び電界効果トラ (3) 連携研究者 ンジスタの製造方法 なし 発明者:太田裕道,小出浩貴,高木利哉,藤 本隆史 権利者:国立大学法人名古屋大学,東京応化 工業株式会社 種類:特許 番号:特開 2012-64687 出願年月日: 2010年 09月 15日 国内外の別:国内